科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 30 年 5月 28 日現在

機関番号: 1 3 9 0 3					
研究種目: 基盤研究(B)(一般)					
研究期間: 2015~2017					
課題番号: 15日04124					
研究課題名(和文)電気化学的なプロトン注入とH+ダイナミクスの解明及びガラスの新機能発現					
研究課題名(英文)Electrochemical proton implantation and H+ dynamics analysis for new					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
名古屋丁業大学・丁学(系)研究科(研究院)・助教					
研究者番号:7 0 5 1 4 4 0 4					
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 12,800,000円					

研究成果の概要(和文):本研究のin-situ FTIR測定より、加湿水素雰囲気での通電によってリン酸塩ガラス中 へのH+注入を実証した。H+注入にはわずかでも水分子の共存が不可欠である。また電気化学圧子圧入装置を用い てプロトン注入によるガラスの著しいクリープ増大を明らかにした。ガラスの燃料電池電解質としての応用や、 電極/電解質の接合に対して重要な知見である。また水素雰囲気での電圧印加による簡便なH+注入を利用したガ ラスの局所改質や加工など、本研究で得られたH+注入の知見の具体的な活用も今後検討する。またプロトン伝導 性ガラスファイバー先端を先鋭化して高電界を印加することで、注入したプロトンを電界放出することに成功し た。

研究成果の概要(英文): Proton implantation into phosphate glasses via an electrochemical reaction under hydrogen atmosphere was successfully confirmed using an originally developed in-situ FTIR equipment. Water molecules are indispensable for the proton implantation. We also confirmed a large creep displacement during the proton implantation by utilizing an originally developed electrochemical indenter. Results obtained here are significant for the application of phosphate glasses for a fuel cell electrolyte and preparation of an electrolyte/electrode assembly. We have also studied about the application of this simple electrochemical proton implantation technique for e.g. a new local modification/processing of glasses. We also confirmed for the first time about a proton emission of the implanted H+ by applying a high voltage for a sharpened proton conducting glass fiber.

研究分野: 無機材料 機能性ガラス材料

キーワード: ガラス プロトン注入 燃料電池 インデンテーション クリープ 逆モンテカルロ プロトン伝導 イオン伝導性ガラス

1. 研究開始当初の背景

ガラスの電気・機械および光学特性は、プロ トン(H⁺)を注入することで大きく変化する。 また H⁺注入によるナノ粒子析出や欠陥生成 なども報告されている。シリカガラスや多成 分ガラスに対する H+注入より、プロトン伝導 性の大幅な向上[1]や透明導電性などガラスの 新しい機能性について報告されている^[2]。そ の他ガラスへの H⁺注入に関して、欠陥生成、 屈折率変化、導波路形成、金属ナノ粒子析出 など H⁺注入による新たな機能発現がこれま で報告されている。また難加工性であるサフ ァイア基板に H⁺注入すると基板の吸光度が 変化し、ArF レーザー照射による微小孔形成 が可能となるなど、近年 H⁺注入技術は幅広い 分野で注目・検討されている。ただし従来の H⁺注入は、主にイオン加速器を用いて実施さ れている。イオン加速器では、高エネルギー・ 高電流密度で試料にイオン注入可能であるが、 高真空中かつ大型の高額装置のため非汎用で あり、イオン加速器(注入器)を用いた H+注入 技術が様々な産業分野に広く普及していると は言いがたい。

溶融法で作製したガラスの H⁺濃度は極め て低いため、ガラスは燃料電池電解質として はほとんど注目されていなかった。一方、我々 は 200~600℃の広い温度範囲でプロトンのみ が伝導する高プロトン伝導性ガラス(H⁺輸率 tn=1)を作製し、当該ガラスを電解質に用いた 燃料電池が出力は 5 mW/cm² 程度と低いもの の、1000時間を超えて連続的に発電すること を示した。溶融ガラスはプロトン濃度が低い ため、燃料電池動作時に水素ガスから解離生 成したプロトンがガラス中に注入され、この プロトンが発電に寄与すると予想した。この 方法では、ガラスへの H⁺注入に上述のような イオン加速器が不要である。また他方、我々 は主に硬度や弾性率など機械特性評価などに 利用される圧子圧入法を利用した独自の電気 化学圧子圧入装置を開発し、これまでに圧子 直下の高圧力場を利用した GPa 級高圧インピ ーダンス測定や、それによるイオン伝導の活 性化体積の評価法などを報告している^[3]。ガ ラスへのH⁺注入量や注入速度、またH⁺注入に 伴うガラスの機械特性を in-situ 評価すること で、H⁺注入/伝導機構とガラス構造との関係を 明確にできると考えた。また迅速・簡便にガラ スにH⁺注入可能となれば、新しい機能性ガラ スの提案や、その将来的な産業応用などが期 待される。

2. 研究の目的

本研究では赤外線分光装置と電気化学圧子 圧入法を用いて、ガラスへのH⁺注入速度やH⁺ 注入による機械特性の変化を in-situ 可能な評価装置を組み、ガラスへの H⁺注入機構や H⁺伝 導機構の解明を目指す。以て新規ガラス電解 質開発やガラスの新機能発現に資することを 目的とする。

3. 研究の方法

(1) In-situ 赤外線分光装置の作成

ガラス中でプロトンは主に OH 基として存 在する。先行研究より燃料電池発電雰囲気で H⁺注入が生じていると考えられたことから、 発電時と同様の雰囲気でガラス中の OH 基濃 度を赤外線分光器(FTIR)より測定する実験装 置を作成した(図1)。ガラス試料は原料を1300 ~1500 ℃で溶融した後、カーボンプレートに 流し出して成形し、アニール後に切断・研磨し て作製した。ガラス両面に中心に孔の開いた 半ドーナツ形状の白金電極を互い違いになる ようにスパッタ蒸着して、外部から直流電源 (GS200, 横河計測株式会社)を用いて所定電圧 を印加した。またピコアンメーター(Keithley 6485)(図中に@と表示)を用いて電流値と FTIR スペクトルを同時取得した。水素雰囲気 下での通電によって燃料電池アノード反応と 同様(H₂→2H⁺+2e⁻)の反応が、また対極で逆 反応が生じる。アルカリ樹脂(光路は CaF2 窓) で周囲を囲い、減圧乾燥や窒素および水素 (4%H2-96%Ar)、またバブリングによって加湿 雰囲気にした。



図 1. 作成した in-situ 赤外分光測定装置の外 観写真および電極配置図

ガラスはインコネル製の自作セルにアロンセ ラミックス(東亞合成)を用いて固定し、ドーナ ツ状電極の中心孔部分(φ=1mm)を赤外線が通 過するように XZ ステージでセルの位置を調 整した。インコネルセルに孔を明けてヒータ ーを導入し、ガラスの温度を制御した。赤外 線分光器は日本分光株式会社製のものを使用 し、トリガーボックス(TCB-4000)を用いて外 部信号で指定時間に自動で FTIR スペクトル 測定できるようにした。直流電源や温度、ト リガーの制御や電流値の読み取りなどはナシ ョナルインスツルメンツ社の cDAQ-9174 と LabVIEW ソフトを用いた。

(2) 電気化学圧子圧入装置の作成

3.(1)と同じく燃料電池発電と同様の反応下 でのガラスの機械特性を評価できるように、 図2に示す圧子圧入装置を作成した。ロード セル[2, TCLZ-1KNA, 東京測器研究所製]およ びレーザー変位計[5. LS-7600. キーエンス社 製]により、荷重と押し込み深さをモニタし、 押し込み深さはピエゾアクチュエーター[1. APA230L, Cedrat Technologies 社製]により制御 した。硬度および耐熱性に優れるインコネル 625 を用いて球形圧子(先端曲率半径 0.5 mm) を作製し、本圧子を電極としても使用した。 ガラスの片表面にリング状の白金電極をスパ ッタして、圧子電極と Pt リング電極間に直流 電源を用いて5Vを印加した。CompactRIO(ナ ショナルインスツルメンツ社製)および LabVIEW ソフトの PID 機能を利用して、任意 の温度や荷重で変位をモニターした。圧子周 辺の温度を制御するため、小型の電気炉(石英 窓)で加熱し、測定雰囲気は 3.(1)と同様に変化 させた。Pt 電極上で水素解離反応が生じ、圧 子側に H⁺が伝導する。





図2 作成した電気化学圧子圧入装置の 外観写真

4. 研究成果

(1) in-situ FTIR 測定によるプロトン注入速度 の評価 先行研究で燃料電池発電試験に使用してい た7.5Na2O・7.5K2O・35P2O5・50SiO2 (mol%)(外 割で3 mol% Al2O3 ドープ)ガラスについて、窒 素や水素中での通電(30 V)および加湿の有無 による赤外吸収スペクトル変化を図3 に示す。 乾燥した窒素および水素中では通電の有無に かかわらずガラス中の OH 基濃度はほぼ変化 しない(H⁺注入は生じない)ことを確認した。 一方で加湿水素雰囲気では、OH 基濃度が顕著 に増大し、わずかでも(相対湿度換算で 0.3%) 水蒸気の存在がガラスへの H⁺注入に必須で あることが明らかとなった。また加湿窒素雰 囲気中でも吸着水によるものと思われる OH 基濃度の上昇が僅かに見られた。



図4に2850 cm⁻¹における加湿水素中(30 V) での OH 基濃度およびピコアンメータによっ て同時計測した電流値の時間変化を示す。x軸 は加湿窒素 → 加湿水素に切り替えた時点を ゼロとしてオフセットした。それぞれのグラ フの黒点線は単一指数関数

$$y = y_0 + A \cdot exp\left\{\frac{-(t-t_0)}{\tau}\right\}$$
(1)

でフィッティングした結果であり、to は加湿 水素に切り替えたオフセット時間、t は緩和時 間、yoとAは定数である。OH 基量と電流値の 増加はいずれも同一の緩和時間(t = 69.5 h)で フィッティングできた。このことから、加湿 水素雰囲気中で通電することによって、ガラ ス中にプロトンが OH 基として導入され、そ れらが直接キャリアとして働くことを実証し た。なお電流値を観測しやすくするために電 圧を 30 V としたが、1 V~3 V 程度でも結果は 同様であった。



図4 水素雰囲気(0.3%RH)の通電下(30 V)にお ける OH 基(@2850 cm⁻¹)の吸光度および電流 値の時間変化 (点線は単一指数関数によるフ ィッティング結果)

リン酸塩ガラスの 0H 基のモル吸光係数は ε = 100~150 L/mol·cm 程度の値が報告されて いる^[4]。FTIR スペクトルの吸光度から OH 基 濃度(mol/L)を求め、得られた値と電流値の関 係を図5 に示す(ε = 120 L/mol·cm と仮定^[4])。 緩和時間が等しいことからも分かるように、 両者は良好な直線関係で表された。この図の 傾きの大きいガラスほどプロトンの易動度が 高いと判断でき、現在もこの点に注目してガ ラス組成や分相の程度と傾きとの関係を引き 続き調べている。



図5OH 基濃度と電流値の関係

プロトン注入によってガラス中の OH 基濃 度が上昇するにはわずかでも加湿が必要であ ることを示した。H⁺によって水分子が電気浸 透のように移動して(2)式で表される反応

$$2\mathrm{H}^{+}:\mathrm{H}_{2}\mathrm{O} + 4(\mathrm{P}\text{-}\mathrm{O}\text{-}\mathrm{P}) \rightarrow 4(\mathrm{P}\text{-}\mathrm{O}\mathrm{H}) + \mathrm{H}_{2}\uparrow \quad (2)$$

が生じ、P-O-Pリン酸鎖の加水分解による一次 反応によってガラス内の OH 基が増加すると 考えられる。この確認のために反応次数を以 下の方法で求めた。 (2)式によると反応速度 v は反応速度定数 を k とすると

$$v = k' [H_2O]^n \cdot [P-O-P(Q^2)]^m$$
(3)

と表される。水蒸気量([H₂O])は十分大きく一 定と仮定すると、vは[P-O-P]によって決まる。 ただし本実験では反応物(P-O-P)では無く生成 する OH 基濃度を測定しており、(2)式より t 時間後に反応するリン酸鎖[P-O-P]_t と同時刻 における OH 基濃度[OH]_t との間に

$$[P-O-P]_t = [OH]_{\infty} - [OH]_t$$
(4)

の関係が成り立つと仮定した(図6)。



図 6 (2) 式を仮定した反応物 (P-O-P リン酸 鎖) と生成物 (OH 基) の時間変化の模式図

以上より、

 $\log v = \log k + m \{\log[OH]_{\infty} - [OH]_t\}$ (5)

が得られる。図4のOH 基の時間変化につい ておよそ 10時間区分ごとにプロトン注入速 度を求め、得られた結果を図7にまとめる。 [OH]∞はフィッティングより見積もった。



図7OH 基濃度と反応速度の関係

得られた傾きより m=1.05 と求まったことか ら、(2)式で示す1次反応によってガラス中に プロトンが注入されることを確認した。また プロトン注入処理前後のガラスのラマンスペ クトル変化からも P-O-P (Q² グループ)に帰属 されるピークの減少と P-OH 基に帰属される Q¹ グループの増加を確認した。

(2) ガラス構造とH+注入速度の関係

構造がより単純な2成分メタリン酸ガラス (50MO・50P₂O₅ (mol%), M=Ca, Sr)を用いて insitu FTIR 測定を行った。示差走査熱量分析 (DSC)より、それぞれのガラス転移温度は 531℃と514℃であった。図8 に加湿水素雰囲 気においてガラス厚みで規格化した OH 基に 帰属されるピークの吸光係数(cm⁻¹)時間変化 を示す(測定温度 350℃)。緩和時間に大きな違 いは見られなかったものの、同じ経過時間で は CaO ガラスと比べて SrO ガラスの方が2倍 程度多くプロトンが注入された。



図 8 MO·P₂O₅ (M=Ca, Sr mo1%)ガラスの 350℃,加湿水素下で通電(3 V)時の OH 基濃 度の時間変化

ガラス構造を検討する目的で、それぞれの ガラスの構造因子 S(Q)を放射光 X 線(SPring-8、BL04B2)を用いて調べた。逆モンテカルロ (RMC)フィッティングの結果と合わせて図 9 に示す。RMC 計算より各元素間の相関距離を 抽出したところ、特に非架橋酸素(NBO)と M²⁺ カチオン間距離に違いが見られ、Ca-NBO(2.36 Å), Sr-NBO(2.52 Å)と求まり相関距離は SrO ガ ラスの方が長いことがわかった。酸素周辺の 解析は中性子回折も併用した方が効果的であ るが、架橋酸素-M²⁺相関はいずれのガラスも 2.5 Å 程度で変化は見られなかった。非架橋酸 素のうち主に P=Ö 非共有電子対(・・は非共有 電子対を示す)と M²⁺カチオン間の相関距離が プロトン注入速度と直接関係することを示し ていると考えられる。電子状態まで掘り下げ て検討できればなぜ SrO ガラスの方が CaO ガ ラスと比べてプロトン注入量が2倍になるか、 という点がより定量的に明らかになると考え られ、引き続き検討を進めている。また in-situ FTIR 測定を様々な温度で実施してプロトン 注入の活性化エネルギーとガラス構造との関 係を調べている。



図 9 MO・P₂O₅ (M=Ca, Sr mol%)ガラスの構造 因子 S(Q)の実験および RMC 計算結果

(3)プロトン注入による機械特性の変化

プロトン注入時のガラスの変形挙動を調べる目的で、H⁺注入下でのin-situ 圧子圧入測定 を実施した。測定条件は乾燥および加湿下で 窒素と水素雰囲気の計4条件で実施した。insitu FTIR 測定でのH⁺注入量の時間変化は単一 指数関数で表されたが、クリープ挙動は特に 初期の数 100 秒程度の変位に対して単一指数 関数ではフィッティングが悪く、全ての4条 件で式(6)の二重指数曲線で良くフィッティン グできた。

$$y = y_0 + A_1 \cdot exp\left\{\frac{-(t-t_0)}{\tau_1}\right\} + A_2 \cdot exp\left\{\frac{-(t-t_0)}{\tau_2}\right\}$$
(6)



図 10 各雰囲気で 5V 通電下において、5 Nに 保持したときの圧入深さの時間変化(点線は 二重指数曲線によるフィッティング結果)

表1 フィッティングより求めたパラメータ

	$ A_1 $	$ au_1$	$ A_2 $	$ au_2$
	(µm)	(s)	(µm)	(s)
N ₂ dry	3	350	2	1501
N ₂ wet	3.76	349	3.36	2382
H ₂ dry	3	350	2.31	1500
H ₂ wet	3.76	360	6.7	8831

各条件におけるクリープ曲線を図10、またフ ィッティングにより得られたパラメータを表 1にまとめる。2種類の緩和時間のうち、変位 の初期に現れる短い緩和時間 τ1 は 350 秒程度、 また長い成分 τ2 は数 1000 秒のオーダーであ った。第一項目の係数 $A_1 \ge \tau_1$ はガス種や加湿 の有無にかかわらず全ての条件でほぼ同程度 であったことから、第一項目はガラスへのプ ロトン注入とは無関係な 200℃における圧子 側(インコネル)の変形に関係すると考えられ る。第二項目について、乾燥条件では窒素と 水素雰囲気のいずれの場合も A2 と T2 に大き な差は見られなかった。いずれの条件でもH+ 注入が生じていないことと良く対応している。 一方、加湿窒素中ではわずかに A2 と T2 の値は 増加した。さらに加湿水素雰囲気では、A2と τ2 のいずれも顕著に値が増加した。加湿水素 雰囲気の通電下ではプロトン注入が生じる。 式(1)の反応でガラスネットワークの切断が起 こり、このプロトン注入が著しいクリープの 増大と関係していることを初めて実証した。

本研究の in-situ FTIR 測定より、水素雰囲気 での通電によってリン酸塩ガラス中への H+ 注入を実証した。H+注入にはわずかでも水分 子が不可欠である。プロトン注入によるガラ スのクリープ増大は今後の燃料電池電解質と しての応用や、電極/電解質界面の接合に対し て重要な知見である。また水素雰囲気での電 圧印加による簡便な H⁺注入を利用したガラ ス表面の局所改質や加工など、本研究で得ら れた H+注入の時定数の知見に対する具体的 な活用にも検討の幅を広げている。またプロ トン伝導性ガラスファイバー先端を先鋭化し て高電界を印加することで、注入したプロト ンを電界放出することに成功した。H⁺以外に も各種イオン伝導性ガラスを先鋭化すること で様々なイオン放出が可能であり、本研究の 幅が広がっている[5,6]。

参考文献: [1] H. Hosono *et al., J. Appl. Phys.*, **81**, 1296 (1997). [2] 細野ら, まてりあ, **37**, 261 (1998). [3] Y. Daiko *et al., Solid State Ionics*, **286**, 96 (2016). [4] Y. Abe et *al., J. Non-Cryst. Solids*, **51**, 357 (1982). [5] Y. Daiko *et al.*, Proc. IEEE 16th Int. Conf. Nanotechnol, 351 (2016), http://dx. doi.org/10.1109/NANO.2016.7751521. [6] Y. Daiko et al., Solid State Ionics, 332, 5 (2018).

5. 主な発表論文等

〔学会発表〕(計17件)

①2 成分リン酸塩ガラス MO-P₂O₅(M=Ca, Sr, Ba)の M²⁺周辺局所構造と H+注入ダイナミクス, JEONG Sumin, <u>大幸裕介</u>, 本多沢雄, 岩本雄二, 日本セラミックス協会 2018 年年会
② Alkaline-earth metal ion dependence of H⁺ implantation in phosphate glass by in-situ electrochemical FT-IR analysis, S. JEONG, <u>Y.</u> DAIKO, S. HONDA, Y. IWAMOTO, The 34th International Japan-Korea Seminar on Ceramics
③リン酸塩ガラスへの電気化学的な H+注入 と機能誘起, 大幸裕介, 村井俊介, 吉田智, 武藤浩行, 早川知克, 第 28 回日本セラミックス 協会 秋季シンポジウム

他 14 件

〔産業財産権〕
○出願状況(計 1件)
名称:イオン発生器
発明者:大幸裕介、水谷聖
番号:特願 2016-056970
出願年月日:2016.03.22
国内外の別:国内

[その他]

ホームページ等 http://researcher.nitech.ac.jp/html/1000 00307_ja.html

 6.研究組織
 (1)研究代表者
 大幸裕介(DAIKO Yusuke)
 名古屋工業大学・工学研究科 助教 研究者番号:70514404

(2)研究分担者
 早川知克(HAYAKAWA Tomokatsu)
 名古屋工業大学・工学研究科 教授
 研究者番号:00293746

吉田智(YOSHIDA Satoshi)
 滋賀県立大学・工学部 准教授
 研究者番号: 20275168

武藤浩行(MUT0 Hiroyuki) 豊橋技術科学大学・工学研究科 教授 研究者番号:20293756

村井俊介 (MURAI Shunsuke) 京都大学・工学研究科 助教 研究者番号:20378805